

맞춤형 Ptfе 내식성 6인치 듀얼 핸들 포토마스크 세척 플라워 바스켓 랙

품목 번호: PL-CP05



소개

고성능 맞춤형 PTFE 6인치 듀얼 핸들 포토마스크 세척 랙은 반도체 및 실험실 습식 공정을 위해 뛰어난 내화학성을 제공합니다. 이 내구성 있는 플라워 바스켓은 강한 산 및 용제 환경에서도 안전한 샘플 처리, 빠른 배수, 오염 없는 세척을 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 RCA 세척	유기물 및 금속 오염 물질을 제거하기 위해 실리콘 웨이퍼를 SC-1 및 SC-2 용액에 순차적으로 침지.	산화제 및 고온 산에 대한 완전한 저항성으로 운반대 분해가 없음.
포토마스크 에칭	강력한 에칭제를 사용하여 크롬 또는 기타 빛 차단층을 제거하는 동안 6인치 포토마스크를 고정.	안전한 위치 고정으로 마스크 진동을 방지하여 고충실도 패턴 전사 및 표면 스크래치 제로를 보장.
태양전지 텍스처링	KOH 또는 HF/HNO ₃ 혼합물을 사용하여 실리콘 표면에 미세 피라미드를 생성하여 빛 흡수를 개선하는 공정.	내구성 있는 듀얼 핸들 설계로 대용량, 딥탱크 산업 환경에서 안전한 취급 가능.
MEMS 및 마이크로유체공학	마이크로 전자 기계 시스템 제조에 사용되는 유리 또는 실리콘 기판의 세척 및 에칭.	재료 순도로 마이크로 스케일 장치 기능을 방해할 수 있는 미량 불순물의 유입을 방지.
추적 분석 실험실 기구	특수 산 증기 세척 또는 침지 중 비이커, 뚜껑 또는 소형 구성 요소를 고정.	금속 이온의 부재가 보장되어(이온 프리) 초미량 원소 분석 지원의 표준으로 사용됨.
전도성 유리 준비	OLED 또는 페로브스카이트 태양전지 연구를 위한 ITO 또는 FTO 코팅 유리 기판 세척.	그리드 설계로 기판 가장자리를 보호하면서 전도층과의 완전한 유체 접촉 가능.
습식 화학 현상	리소그래피 워크플로우에서 현상제 용액을 통해 노출된 포토레지스트 코팅 웨이퍼 운반.	다양한 유기 현상제에 걸친 화학적 안정성으로 일관된 결과 및 재료 상호작용 제로 보장.

매개변수	사양 세부사항 (모델: PL-CP05)
주요 재료	100% 고순도 순수 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE)
기판 호환성	표준 6인치 (152.4 mm) 포토마스크, 웨이퍼 또는 유리
핸들 구성	균형 잡힌 수직 리프팅을 위한 듀얼 핸들 보강 지지대
내열성	-200°C ~ +260°C (-328°F ~ +500°F)
화학적 호환성	범용 (모든 산, 염기, 유기 용제 및 피라한 용액)
슬롯 구성	맞춤형 슬롯 너비, 피치 및 총 수용량 (표준 10/25 슬롯)
구조적 특징	빠른 배수를 위한 CNC 가공 그리드 베이스; 등근 샘플 접촉점
표면 마감	매끄러운, 무기공 CNC 가공 PTFE 표면 (낮은 마찰력)
핸들 높이	특정 세척 탱크 깊이에 맞게 맞춤 설정 가능
금속 함량	제로 (금속 없는 구조)